

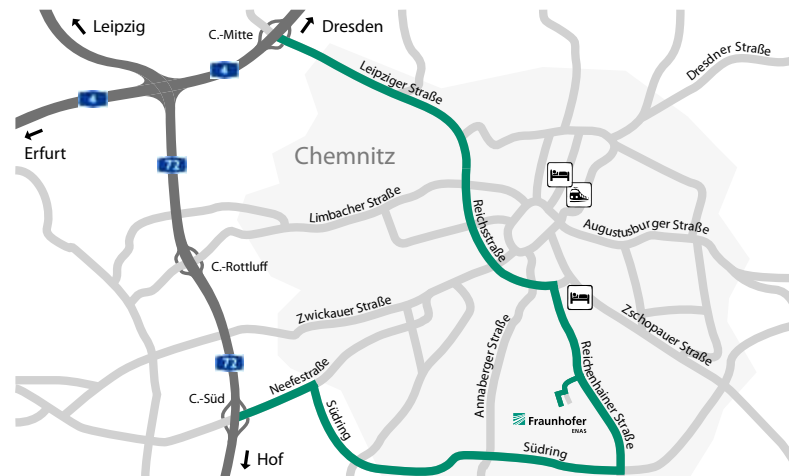
Anmeldung:
 Bitte senden Sie Ihre Anmeldung
 bis zum 23. Oktober 2015
 per E-Mail an
events@enas.fraunhofer.de

Hotel:
 Für Empfehlungen und Informationen zu Hotelreservierungen
 wenden Sie sich bitte an
 Frau Anke Geike
 Telefon: +49 371 45001-202
anke.geike@enas.fraunhofer.de

Kontakt:

Dr. Jens-Wolfram Erben
 Telefon: +49 371 45001-269
jens-wolfram.erben@enas.fraunhofer.de

Dr. Georg Heldt
 Telefon: +49 371 45001-438
georg.heldt@enas.fraunhofer.de



Fraunhofer ENAS
 Technologie-Campus 3, 09126 Chemnitz
 (Zufahrt zum Technologie-Campus über Rosenbergstraße oder
 Fraunhoferstraße)

Telefon: +49 371 45001-0
 Fax: +49 371 45001-101
info@enas.fraunhofer.de
www.enas.fraunhofer.de

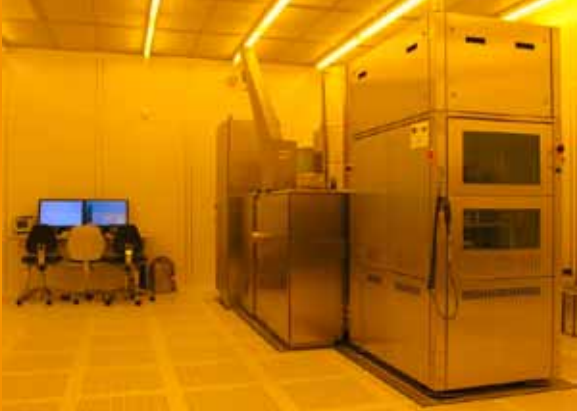
4. NOVEMBER 2015 | FRAUNHOFER ENAS
 TECHNOLOGIE-CAMPUS 3 | 09126 CHEMNITZ

CHEMNITZER SEMINAR

"ELEKTRONENSTRAHL-LITHOGRAFIE"

ANLÄSSLICH DER EINWEIHUNG DES NANO-
 LITHOGRAFIE-LABS AM FRAUNHOFER ENAS





CHEMNITZER SEMINAR “ELEKTRONENSTRAHL- LITHOGRAFIE”

PROGRAMM

MITTWOCH
4. NOVEMBER 2015

Das Fraunhofer ENAS verfügt über spezifisches technologisches Know-how auf dem Gebiet der Smart Systems Integration sowie Mikro- und Nanoelektronik.

Im Rahmen eines langfristig angelegten Investitionsvorhabens, das von der Europäischen Union, dem Bund, dem Land Sachsen und der Fraunhofer-Gesellschaft gefördert wurde, gelang es, eine nachhaltige Verbesserung des technischen und technologischen Potentials unseres Institutes durch die Anschaffung und Inbetriebnahme von Ausrüstungen für die Herstellung von Nanometerstrukturen mit einer Auflösung von bis zu 20 nm zu erreichen. Kernkomponente der Gesamtinvestition ist die 50 kV Elektronenstrahl-Belichtungsanlage SB254 der Vistec Electron Beam GmbH (Jena), die eine hohe Flexibilität in der Bearbeitung von Forschungsthemen mit Nanostrukturen künftiger Generationen gestattet.

Unser Ziel ist es, anlässlich der Einweihung des Nanolithografie-Labs am Fraunhofer ENAS mit Fachkollegen und Interessenten sowie potentiellen Nutzern und Anwendern der Elektronenstrahl-lithografie ins Gespräch zu kommen und die neuen Möglichkeiten an unserem Institut vorzustellen.

Wir freuen uns, dass wir für diese Veranstaltung eine Reihe von exzellenten Referenten gewinnen konnten, die mit einem breiten Spektrum an anwendungsorientierten Vortragsthemen zu einem informativen Workshop beitragen werden.

- | | |
|-------------------|---|
| 10:00 – 10:10 Uhr | Begrüßung Prof. Dr. Thomas Geßner,
Dr. Danny Reuter, Fraunhofer ENAS |
| 10:10 – 10:40 Uhr | Variable Shaped Beam Lithography for
Micro- and Nanotechnology
Dr. Matthias Hädrich, Vistec Electron Beam
GmbH, Jena |
| 10:40 – 11:10 Uhr | E-Beam-Applikationen mit
traditionellen und neuentwickelten
E-Beam-Resists
Matthias Schirmer, Allresist GmbH, Strausberg |
| 11:10 – 11:40 Uhr | Elektronenstrahlolithographie für die
Optik – schnell, flexibel und präzise
Dr. Ernst-Bernhard Kley, Friedrich-Schiller-
Universität Jena, Institute of Applied Physics,
Dr. Uwe D. Zeitner, Fraunhofer IOF, Jena |
| 11:40 – 12:10 Uhr | E-Beam-Lithographie am IMS
– Applikationen vom CMOS-
Direktschreiben bis zum analogen
Nanoimprint Template
Dr. Mathias Irmischer, Institut für
Mikroelektronik (IMS CHIPS), Stuttgart |
| 12:10 – 13:30 Uhr | Mittagspause |

- | | |
|-------------------|---|
| 13:30 – 14:00 Uhr | Zonenplatten für die hochauflösende
Röntgenmikroskopie
Dr. Stefan Rehbein, Helmholtz-Zentrum
Berlin für Materialien und Energie, Berlin |
| 14:00 – 14:30 Uhr | Module-Integration in eine 0,13 µm
BICMOS-Technologie/ ESL-Applikationen
Dr. Andreas Mai, Leibniz Institut für innova-
tive Mikroelektronik (IHP), Frankfurt/ O. |
| 14:30 – 15:00 Uhr | Elektronenstrahlolithographie –
Anwendungen am Fraunhofer
Heinrich-Hertz-Institut
Ralf Steingrüber, Heinrich-Hertz-Institut, Berlin |
| 15:00 – 15:30 Uhr | Kaffeepause |
| 15:30 – 16:00 Uhr | E-Beam Direktschreiben am Fraunhofer
IPMS: Maskenloses Strukturieren für
CMOS und MEMS/NEMS Applikationen
Dr. Christoph Hohle, Fraunhofer IPMS-CNT,
Dresden |
| 16:00 – 16:30 Uhr | Anwendung der Elektronenstrahl-
lithografie für MEMS/NEMS und
1D-Elektronik
Dr. Danny Reuter, Fraunhofer ENAS |